

DIN 50453-2:2023-08 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen - Teil 2: Siliciumdioxid-Schichten, Optisches Verfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens	4
5 Geräte	4
6 Silicium-Substrat	5
7 Zusammensetzung der Ätzmischungen	5
8 Einflüsse auf das Messergebnis	5
8.1 Struktur der Siliciumdioxid-Schicht	5
8.2 Temperatur	5
8.3 Dotierung	5
9 Probenvorbereitung	5
10 Durchführung	5
11 Auswertung	7
12 Präzision des Verfahrens	7
13 Prüfbericht	8
Literaturhinweise	9
 Bilder	
Bild 1 — Prüfaufbau zur Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen	6